

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
 【発行日】平成 29 年 8 月 17 日 (2017.8.17)

【公開番号】特開 2016-82180 (P2016-82180A)  
 【公開日】平成 28 年 5 月 16 日 (2016.5.16)  
 【年通号数】公開・登録公報 2016-029  
 【出願番号】特願 2014-214964 (P2014-214964)  
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/3065 (2006.01)

H 0 5 H 1/46 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/302 1 0 1 C

H 0 5 H 1/46 M

H 0 5 H 1/46 L

【手続補正書】  
 【提出日】平成 29 年 6 月 14 日 (2017.6.14)  
 【手続補正 1】  
 【補正対象書類名】特許請求の範囲  
 【補正対象項目名】全文  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【特許請求の範囲】  
 【請求項 1】

試料がプラズマ処理される処理室と、前記処理室の外側に配置され誘導磁場を生成する複数の誘導コイルと、前記誘導コイルに高周波電力を供給する一つの高周波電源とを備えるプラズマ処理装置において、

前記誘導コイルの各々に前記高周波電力を供給するタイミングを異ならせる電力時分割器をさらに備えることを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項 2】

請求項 1 に記載のプラズマ処理装置において、

前記高周波電源と前記電力時分割器の間に配置され前記高周波電力の反射を低減する整合器をさらに備えることを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項 3】

請求項 1 または請求項 2 に記載のプラズマ処理装置において、

前記電力時分割器は、500 Hz から前記高周波電源の周波数を 100 で除した値までの範囲の周波数で前記誘導コイルの各々に前記高周波電力を供給するタイミングを異ならせ

、

前記整合器の整合位置は、プラズマ処理中、プラズマ処理中のプラズマが安定した時点の整合位置に固定されることを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項 4】

請求項 1 ないし請求項 3 のいずれか一項に記載のプラズマ処理装置において、

前記処理室の外側に配置され前記プラズマと容量結合する容量結合アンテナをさらに備え、

前記容量結合アンテナは、前記高周波電源から高周波電力を供給されることを特徴とするプラズマ処理装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 1 0 】

本発明は、試料がプラズマ処理される処理室と、前記処理室の外側に配置され誘導磁場を生成する複数の誘導コイルと、前記誘導コイルに高周波電力を供給する一つの高周波電源とを備えるプラズマ処理装置において、前記誘導コイルの各々に前記高周波電力を供給するタイミングを異ならせる電力時分割器をさらに備えることを特徴とする。